特集 コモンレールシステム用超高圧センサの開発*

High-Pressure Sensors for Common Rail Systems

日中宏明	伊藤 治	鈴木康利
Iiroaki TANAKA	Osamu ITO	Yasutoshi SUZUKI

The direct injection diesel engine system was developed to solve the problems of conventional diesel engine systems: emissions of PM (Particulate Matter) and high emissions of NOx (Nitrogen Oxides). The common rail pressure sensor is a key sensor in the system, which requires high-pressure resistance of 160MPa and accuracy of $\pm 1\%$. This paper discusses our development of a new generation of common rail system high-pressure sensors that are structurally simpler than conventional sensors, while meeting the above requirements.

Key words : Common rail, Pressure sensor, Diesel engine, Metal-touch-seal

1. まえがき

ディーゼルエンジンのコモンレール方式は,高圧ポ ンプにて生成した高圧燃料をコモンレール(蓄圧室) に蓄え,インジェクタ内の電磁弁によってノズル背圧 を制御し,最適化された噴射を実現化するという電子 制御燃料噴射システムである。

Fig.1にコモンレールシステムの構成を示す.



Fig. 1 Direct injection diesel engine system configuration

コモンレール内の燃料圧力は高圧ポンプの燃料吐出 量を電磁弁によって噴射量を,コンプレッサによって 加圧し,コントロールされる.その燃料圧力はコモン レールに設置された圧力センサ(コモンレール圧セン サ)により検出され,エンジンの回転速度と負荷に応 じて設定された最適値に高圧ポンプの電磁弁によりフ ィードバック制御される¹

我々はこれまでハーメチック構造を用い,シールダ イアフラムで受圧し,封入オイルを圧力媒体として, 単結晶シリコン圧力センサデバイスで圧力-電気変換 する高圧センサを開発してきた²⁰

しかし,一層,低エミッションの実現のために,コ モンレール圧センサにはシステム全体での高圧力化と 高精度化を実現すべく,160MPaの高耐圧と±1%の高 精度が要求され,従来構造では,耐圧・精度の面で達 成が難しいと判断し,全く新しい構造による超高圧セ ンサの設計に着手した.

本論文はこの要求を満足する新構造の超高圧センサ 開発に関するものである.

2. 高耐圧設計

Fig. 2に開発したコモンレールシステム用超高圧センサの構造図を示す.ハウジングーステム間,ハウジングーコモンレール間の超高圧媒体の封止には、メタルタッチシール構造を用いている.検出部の歪み伝達部は金属ステムに薄肉のダイアフラム部を設け、高圧の燃料を受圧する.圧力によりダイアフラム部に発生する応力を、直上に接着された単結晶シリコンピエゾ抵抗素子にて電気変換する.構造上、最も大きくセンサ性能に影響を及ぼす構成部品は、センシング部を成すシリコンセンサチップ及び金属ダイアフラムである.



Fig. 2 Sensing part of next-generation high-pressure sensor for common rail systems

*(社)自動車技術会の了解を得て、「2002年秋季大会学術講演会前刷集」No.87-02,62より一部加筆して転載

Fig. 2に示すセンシング部の課題の第1は高耐圧設計である.以下にその詳細を述べる.

Fig. 2の金属ステムには二つの役割がある。一つは 160MPaの超高圧に耐えること、もう一つは金属ステ ム上の単結晶シリコンピエゾ抵抗素子に十分な応力を 伝えることである。有限要素法(FEM)を用いた応力解 析により、金属ステムの最適形状設計を行った。

Fig. 3にスクリューと金属ステムのFEM応力解析結 果の1例を示す.スクリューにて金属ステムをハウジ ングに押しつけ160MPaに耐える封止を実現している. スクリューに与える軸力により,金属ステムの図中A 部に応力集中が発生する.このため,金属ステムの材 料強度を考慮した形状設計が必要になる.

A部の発生応力に影響を及ぼす形状パラメータはス テム長さLと軸力受け面角度θである.**Fig.4**に軸力 受け面角度θとA部発生応力の関係を示す.θが45°



Fig. 3 Screw and metal stem FEM analysis results





のとき,A部最大発生応力が最小になることが分かる. なお,LはA部発生応力とアッセンブリ形状の制約か らその寸法を決定している.

次に,金属ダイアフラム上のSiピエゾ抵抗素子に必要な応力を与えるダイアフラム形状の設計を行なった.

Fig. 5に金属ダイアフラム部のFEM応力解析結果の 1例を示す.解析より,金属ダイアフラムに発生する 応力は,ダイアフラム厚とダイアフラムR部の曲率に 関係することが明らかになった.接着層である低融点 ガラスの材料強度以下で,かつシリコンピエゾ抵抗素 子に必要とされる応力を確保できる寸法として,ダイ アフラム厚1.4mm,ダイアフラムR部の曲率半径 0.9mmを採用した.



Fig. 5 Metal diaphragm FEM analysis result

3. 高精度設計

金属ステム直上に接着されるシリコン単結晶ピエ ゾ抵抗素子は、薄膜シリコン多結晶ピエゾ抵抗素子に くらべ3~10倍のゲージファクタを持つため³⁹、感度を 3~10倍にすることができ,センサ特性の高精度化に 有利となる.今回、一30~120℃の使用温度範囲で±1 %F.S.の高精度を達成するために、以下の素子構造及 び設計手法を採用した.

① (100) 単結晶Si基板採用

② 最適ゲージ配置設計

3.1 圧力センサの出力誤差成分

理想的な圧力センサの出力特性は、印加圧力に比例 して出力が増加する.しかし、実際には種々の誤差成 分が存在している.特にシリコンピエゾ抵抗素子使用 時には、誤差成分として、オフセット電圧とその温度 特性、感度とその温度特性がある.さらに、圧力に関 する非直線性誤差がある.Fig.6に半導体式圧力セン サの非直線性誤差について、詳しく説明する.

Fig. 6①にオフセット電圧(圧力無印加時出力)の 温度特性の非直線性誤差(TNO)を示す.TNOは1 次成分の差(TCVoff(HT:高温側)-TCVoff(LT:低 温側))で表される.Fig.6②に圧力特性の非直線性 (NLp)を示す.NLpは,使用圧力範囲の中心での圧 力の理想直線からのずれをいう.Fig.6③は感度(F.S. 圧力印加時出力)の温度特性の非直線性を示す.TNS も1次成分の差(TCS(HT:高温側)-TCS(LT:低温 側))で表される.



TNO: non-linearity of offset voltage temperature characteristics
 NLp: non-linearity of offset voltage pressure characteristics
 TNS: non-linearity of sensitivity temperature characteristics

Fig. 6 Non-linearity characteristic of semiconductor pressure sensor

直線性誤差は,出力回路で調整し,低減可能である が,非直線性誤差は,簡単な回路での調整は困難である.

今回,高精度化を達成するためには、この非直線性 誤差を、センサデバイス構造を最適設計することによ り、ほぼ0にすることを試みた。

最適設計に用いたのは,我々が独自に構築したセン サデバイスシミュレーションである⁴ シミュレーショ ンの精度を決定する主要因の一つは構造材料の使用温 度範囲での材料物性値(線膨張係数,ヤング率,ポア ソン比)の正確さである.今回金属ステムの材料物性 を評価するには,超音波法(超音波の反射波強度の差 から物性値を測定する方法)⁵⁵を用い,一50~500℃で の金属ステムの物性値を求め,実際の工程での温度変 動も考慮に入れ,使用範囲内の発生応力である-30~ 120℃での温度依存性,0~200MPaでの圧力依存性を 詳細に検討を行い,ピエゾ抵抗の設置範囲及び位置を 決定した.

3.2 Si基板面方位

半導体ピエゾ抵抗素子の抵抗配置は,面方位により 配置が異なる.今回はステム形状から,最適化を行った.

Si (100) ピエゾ抵抗素子のNlpは, 次式で表される.

 $Nlp = -0.25 \eta \, 44/\pi \, 44 \cdot \{(\sigma \mathbf{x} \mathbf{x}' - \sigma \mathbf{y} \mathbf{y}') + (\sigma \mathbf{x} \mathbf{x} - \sigma \mathbf{y} \mathbf{y})\} \times 100 \ (\%FS)$ (1)

ここで, $\eta 44: \pi 4402$ 次係数

(1) 式からNlpを0にするには, $\sigma x x' - \sigma y y'$ = 0 かつ $\sigma x x - \sigma y y = 0$ となるようにすればよい と言える. **Fig. 7**にセンサデバイスシミュレーション を用いて解析したFEM応力解析結果を示す.

図から金属ダイアフラム部の内径に対して, ピエゾ 抵抗ゲージを同心円状に配置することにより, 直径方 向の応力成分 σ x x, σ yy, かつ接線方向の応力成 分 σ x x', σ yy' を両立できるため, Nlpを0にす ることができる.



Fig. 7 FEM stress analysis result for (100) silicon

また、TNSは、($\sigma x x' - \sigma y y'$) + ($\sigma x x - \sigma y y$) の温度特性に比例するので、($\sigma x x' - \sigma y y$) y') + ($\sigma x x - \sigma y y$) を0にできる配置にピエゾ 抵抗ゲージを配置すれば、TNSを0に近づけることが できる.

3.3 最適ゲージ配置

オフセット電圧の温度特性は下式で求められる.

$$\mathbf{e} = 1 / 2 \times \mathbf{i} \times \mathbf{R} \pi 44 \ (\sigma \mathbf{x} \mathbf{x} - \sigma \mathbf{y} \mathbf{y}) \tag{2}$$

ここで, i : ゲージ電流 R π 44:温度依存性を含む係数

(2) 式より, TNOを0にするためには, 印加圧 カ=0の時に, 温度が変化してもピエゾ抵抗ゲージに 発生する応力の直径と接線成分を等しくする必要があ る.

そこで、FEM解析を用いて最適ゲージ配置を調査 した.その方法はSiチップ上の低温側と高温側の応力 値の差を分布として求めることである.応力=0とな る領域にピエゾ抵抗ゲージを配置すれば、理論上、 TNO=0とすることができる.

4. 試作評価結果

Si (100)面でピエゾ抵抗ゲージの配置を最適化した 圧力センサのNlp, TNO, TNSの試作評価結果を**Fig. 8** に示す. 図からNlp, TNO, TNSが予想どおりほぼ 0 となることが分かる.



Fig. 8 Results of prototype evaluations for NIp, TNO, and TNS

Fig. 9はアッセンブリの写真を示す.アッセンブリの寸法は27mm×63mmである.



Fig. 9 Photograph of sensor assembly

Fig. 10にアッセンブリの温度特性の1例として, 印加圧力80MPa時の温度特性を示す.ほぼ±1%F.S. の高精度を満足していることが分かる.



Fig. 10 Assembly temperature characteristics

20~169MPaでの圧力サイクル耐久試験結果をFig. 11 に示す.耐久変動は見られず,コモンレール圧力下で 十分に使用可能であることが明らかになった.



Fig. 11 Pressure cycle test results

特 集

5. おわりに

160MPaの高耐圧と±1%の高精度を満足するコモン レールシステム用超高圧センサの開発に取り組み,以 下の結果を得た.

- (1) 高耐圧化に関して,メタルタッチシール構造を 採用し,センシング部の金属ステムの耐圧設計を 行った.FEM解析により,ステム長さと軸力受 け面角度の最適形状を明らかにした.
- (2)高精度化に関して、センサデバイスシミュレーションを用いて、センサ特性の非直線性を低減する構造設計を行い、温度特性を使用範囲内でほぼ0にすることができた。

- (3) (100)単結晶シリコン基板を用い、ゲージ配置 を最適化することにより、圧力の非直線性分をほ ぼ0にすることができた。
- (4) 開発したコモンレール圧センサは圧力特性精 度±1%を達成し,160MPaまでの圧力サイクル耐 久試験を満足することを確認した.

<参考文献>

- 伊藤昇平:日本エネルギー学会誌, VOL.80, No.3 (2001)
- 2) 大竹精一郎他: SAE980271
- 3) 深沢剛他: SAE860473
- 4) 横森巖他: CONVERGENCE2000 2000-01-C054
- 5) 桜井裕:金属臨時増刊号 94/04 pp.187-191.

田中 宏明 (たなか び 半導体圧力 開発・設計

田中 宏明
 (たなか ひろあき)
 半導体圧力センサデバイスの
 開発・設計に従事

・設計に従事



鈴木 康利(すずき やすとし)半導体センサの開発に従事

<著 者>

伊藤 治
(いとう おさむ)
半導体圧力センサの開発・設計に
従事